



マルバーン・パナリティカル製品
予算申請用カタログ



マルバーン・パナリティカル製品一覧表

マルバーン・パナリティカルは、粒子計測やX線分析など、多彩な測定機器を揃えています。半世紀以上にわたるリーディングカンパニーとして培われた分析機器やサポート、サービスやセミナーが皆様の研究開発の一助となれば幸いです。

| | 500万円以下、別途ご照会 | 501万円～1,000万円 | 1,001万円以上 |
|-------------|--|---|--|
| 粒子計測 | インライン粒子測定プローブ P.5 レーザー回折式粒子径分布測定装置 P.3 電気的検知帯方式粒子径分布測定装置 P.6 | 粒子径・ゼータ電位・分子量測定装置 P.4 レーザー回折式粒子径分布測定装置 P.3 | 粒子径・ゼータ電位・分子量測定装置 P.4 粒子画像分析装置 P.3 ナノトラッキング粒子径測定装置 P.4 スプレーレーザー回折式粒子径分布測定装置 P.3 |
| 粒子計測・流動性分析 | | 粉体流動性分析装置 P.6 | |
| 液体クロマトグラフィ | | | 高感度・高精度・高性能マルチ検出器 P.7 多角度光散乱検出器 P.7 |
| マイクロカロリメーター | | | 分子間相互作用解析装置 P.8 熱安定性評価装置 P.8 |
| 元素分析 | 蛍光X線元素分析装置 P.9 試料前処理装置 P.10 | 蛍光X線元素分析装置 P.9 試料前処理装置 P.10 | 蛍光X線元素分析装置 P.10 |
| 構造解析 | | 卓上型X線回折装置 P.11 | 多目的X線回折装置 P.11 |

| 掲載ページ | 機器名 | 測定範囲 |
|-------|---|---|
| 測定原理 | | 0.1nm 1nm 10nm 100nm 1μm 10μm 100μm 1mm |
| P.3 | レーザー回折式粒子径分布測定装置 マスターサイザー3000 レーザー回折・散乱法 | 0.01 ~ 3,500 μm |
| P.3 | スプレー専用レーザー回折式粒子径分布測定装置 スプレーテック レーザー回折・散乱法 | 0.1 ~ 2,000 μm |
| P.3 | 粒子画像分析装置 モフォロギ4シリーズ 静的画像解析法 | 0.5 μm ~ 13 mm ※貼り合わせ機能使用時 |
| P.4 | 粒子径・ゼータ電位・分子量測定装置 ゼータサイザーアドバンスシリーズ ゼータ電位：電気泳動光散乱法 粒子径：動的光散乱法 分子量：静的光散乱法 | 0.3 nm ~ 10 μm |
| P.4 | ナノトラッキング粒子径測定装置 ナノサイト NS300 ナノトラッキング法 | 10 nm ~ 2 μm |

| 掲載ページ | 機器名 | 測定範囲 |
|-------|---|---|
| 測定原理 | | 0.1nm 1nm 10nm 100nm 1μm 10μm 100μm 1mm |
| P.5 | オンライン・インラインレーザー回折式粒子径分布測定機 インシテック レーザー回折・散乱法 | 0.1 ~ 2,500 μm |
| P.5 | インライン粒子測定プローブ Parsum 空間フィルタ速度計測法 | 50 ~ 6,000 μm |
| P.6 | 電気的検知帯方式粒子径分布測定装置 CDA®-1000X 電気的検知帯法 | 0.5 ~ 120 μm |

粒子計測

レーザ回折式粒子径分布測定装置

マスターサイザー 3000 湿式／乾式

希望販売価格（税抜）775万円～

マスターサイザー 3000E [希望販売価格（税抜）533万円～]

測定範囲は0.01～3,500 μm という幅広い測定レンジを実現。研究開発から品質管理といった多様な用途において、乾式・湿式といった測定方法や粉体やエマルジョンといったサンプルの性状に関わらず幅広く対応します。

特長

- 装置本体は、W690 mm × D300 mm × H450 mmとコンパクト
- 様々なサンプルに対応可能な、5種類の湿式分散ユニット
- 乾式分散ユニットは空気力学に基づき壊れやすい粒子から凝集粒子まで最適な分散を実現
- 1秒間に10,000回の高速度データ取得により、良好な再現性と精度の高さを両立
- オプションとして、フロー式粒子画像撮像ユニットや7 mL微量セル・高濃度ペーストセルもご用意



測定範囲

0.01～3,500 μm

スプレー専用レーザ回折式粒子径分布測定装置

スプレーテック スプレー

希望販売価格（税抜）1,240万円～

気中に散布された粒子を瞬時に正確に測定します。噴霧状態を瞬間ごとにディスプレイし、高精度でリアルタイムな測定を実現しました。

特長

- 最大10 kHzの高速度測定で噴霧中の粒子径の急激な経時変化をキャッチ
- 多重散乱補正機能により高精度な噴霧粒子でも正確に測定
- 鼻孔スプレー・カスケードインパクト・湿式セル等豊富なオプション



測定範囲

0.1～2,000 μm

粒子画像およびラマン分光分析装置

モフォロギ 4 シリーズ 湿式／乾式

希望販売価格（税抜）1,475万円～（PC込）

ラマン分光分析装置付モフォロギ 4-IDについては別途お問い合わせください。

医薬品やセラミックス、電池や化学品などに適応可能な分析装置です。全自動で粒子径と粒子形状を測定。また、ラマン分光機能を加えたモフォロギ 4-IDは、粒子径と粒子形状情報の機能に加え、化学情報（ラマンスペクトル）を取得します。

特長

- 本体一体式の粉体分散ユニットが再現性の高い自動分散を実現
- ウェットセル、フィルターオプションなど豊富なサンプリングアクセサリに対応
- 全自動化可能。研究からQA/QCまで幅広い対応



測定範囲

0.5 μm ～1,300 μm

ラマン分光法 1 μm ～1,300 μm （化学分析）

粒子計測

粒子径・ゼータ電位・分子量測定装置 ゼータサイザーアドバンスシリーズ

希望販売価格（税抜） 763万円～（Lab）
958万円～（Pro）
1,250万円～（Ultra）

3機種×2系統の計6機種に生まれ変わったゼータサイザーアドバンスシリーズ。さまざまなラインナップで、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーの研究開発・品質管理に貢献します。

特長

- 新型アルゴリズムを搭載し、粗大粒子の影響を最小に抑えての粒子径測定が可能
- 多角度動的光散乱（MADLS）を使用し、粒子径分布の精度、分解能力が向上^{*1}、粒子濃度情報も表示^{*2}
- 高濃度サンプルに対応
- 各種サンプルセル、自動滴定装置（MPT-3）などの豊富なオプションをご用意
- バンドパスフィルタを標準搭載、ソフト上で ON / OFF の切替が可能^{*3}

*1 MADLS は Ultra-Blue、Red で使用可能

*2 粒子濃度解析は、Ultra-Red のみ

*3 Pro-Blue、Red、Ultra-Blue、Red のみ



粒子径測定範囲

0.3 nm ~ 10 μm

ゼータ電位測定範囲

3.8 nm ~ 100 μm

ナノトラッキング粒子径測定装置 ナノサイト NS300

希望販売価格（税抜） 1,300万円～

粒子のブラウン運動を追跡し、粒子ごとに測定するため、高い分解能での粒子径分布や粒子個数濃度が得られます。

特長

- 粒子のブラウン運動を画像追跡する新方式
- 個数基準による粒子径分布表示
- 粒子濃度の算出
- 粒子の屈折率パラメータが不要



測定範囲

10 nm ~ 2 μm

粒子計測

オンライン・インライン レーザ回折式粒子径分布測定機 インシテック

販売価格をご照会下さい。

粉体製造プロセスの現場では、製品の粒子径分布測定は必須です。インシテックは乾式、湿式プロセスいずれにも対応可能な全自動粒子径分布測定機です。刻々と表示されるプロセス配管内のリアルタイムな粒子径分布データを利用し、上流の製造機器をフィードバック制御することも可能です。

特長

- 製造プロセスへの取り付けが可能な堅牢な設計
- 24時間連続モニタリング



仕様

| |
|--|
| 測定原理: レーザ回折法 (Mie理論とFraunhofer近似および多重散乱補正機能〔特許〕) |
| 測定範囲: 0.1 ~ 2,500 μm |
| 光源: 半導体レーザー (波長 λ =670 nm 1 mW) |
| オプション: 本質安全防爆仕様 ATEX (Ex ia IIC T4) |

インライン粒子測定プローブ Parsum

販売価格をご照会下さい。

堅牢で使いやすいインラインのプローブ型粒子径測定機です。

特長

- コンパクトな光学系
- 粒子の高速通過に対応
- 毎秒 10,000 粒子まで測定
- 防爆対応



仕様

| |
|---|
| 測定原理: 空間フィルタ速度計測法 |
| 測定範囲: 50 ~ 6,000 μm |
| 測定ポイント動作温度: -20 $^{\circ}\text{C}$ ~ 100 $^{\circ}\text{C}$ |

粒子計測・流動性分析

電氣的検知帯方式粒子径分布測定装置

CDA[®]-1000X 湿式

希望販売価格（税抜）455万円～

必要最小限な機能と、コンパクトな設計でコストを抑えた電氣的検地帯方式粒子径分布測定装置です。

特長

- ディスクリ移動、粒子径分布再解析、粒子径分布重ね合わせ、差分分析など可能な高機能ソフトウェア
- 最大 50 万個の粒子測定が可能
- 電源オンでセルフチェックと流路を洗浄、わずか 2 分でスタンバイ



測定範囲

0.5 ~ 120 μm

粉体流動性分析装置

パウダーレオメーター FT4

希望販売価格（税抜）993万円～

測定前の粉体サンプルを、そのままの状態ですべて測定します。せん断応力や壁面摩擦など測定項目が豊富で、粉体の流動性評価を再現性よく数値化。

特長

- 10 ml のサンプルから測定可能
- 測定前のコンディショニングサイクルによる再現性の良い測定
- 多彩な流動性測定を 1 台で実現



試験項目

安定性試験、流速変化試験、圧縮試験、
通気試験、透過性試験、圧縮性試験、
せん断試験、壁面摩擦試験

液体クロマトグラフィ・検出器

高感度・高精度・高性能マルチ検出器 GPC/SEC システム OMNISEC

希望販売価格（税抜）1,074 万円～

（GPC/SEC 用マルチ検出器：他社 GPC/SEC 接続用マルチ検出器、RI 検出器、光散乱（直角・低角）検出器）

希望販売価格（税抜）1,601 万円～

（マルチ検出器 GPC システム：GPC システム、RI 検出器、光散乱（直角・低角）検出器）



最大限に感度を高めたマルチ検出器 GPC/SEC システムにより、希薄サンプルや低分子量サンプルも高精度・高再現性で測定します。

特長

- RI、PDA、光散乱、粘度の最大 4 種の検出器を搭載
- 7°（低角）、90°（直角）光散乱検出器により、分子の形状に依存しない絶対分子量測定が可能
- 4 キャピラリー式粘度計により、固有粘度を測定
- カラムオープンと検出器チャンバーは 20 ～ 60 °C で温調
- ポンプ洗浄機構付きで高塩濃度/バッファーにも対応
- オートサンプラーはサンプルロスゼロにでき、2 μl から注入可能、サンプルトレイは、4 ～ 60 °C での温調が可能で劣化しやすいタンパク質や、保温が必要なポリマーサンプルに対応
- 配管の交換が容易な粘度計など、壊れにくさとメンテナンスしやすさを追求

GPC/SEC 用多角度光散乱検出器 Viscotek SEC-MALS 20

希望販売価格（税抜）1,580 万円～



20 角度で散乱光を測定する GPC/SEC 用多角度光散乱検出器（MALS）です。

特長

- ゲル浸透クロマトグラフィー（GPC）/ サイズ排除クロマトグラフィー（SEC）用マルチアングル（多角度）光散乱検出器
- 20 角度での散乱光を同時に測定することにより、溶出体積に依存しない絶対分子量を算出
- 散乱光の散乱角度依存性データから高分子の慣性半径 R_g を正確に算出

マイクロカロリメーター

分子間相互作用解析装置

MicroCal ITC シリーズ

希望販売価格（税抜）2,370 万円～

アカデミア価格^{*1}（税抜）1,830 万円～

溶液中の分子が相互作用したときに生じる微小な熱量変化を測定し、結合の強さ、メカニズムを解析します。

特長

- 溶液中の分子間相互作用をダイレクトに測定
- サンプルのラベル化および固定化が不要
- 分子量の制限なし
- サンプルの充填、セル洗浄など全機能を完全自動制御^{*2}



取得可能パラメータ

K_D 、結合比、 ΔH 、 ΔS 、 ΔG

測定温度範囲

2 ~ 80 °C

セル容量

200 μ L

生体分子安定性評価装置

MicroCal DSC シリーズ

希望販売価格（税抜）2,050 万円～

アカデミア価格^{*1}（税抜）1,350 万円～

溶液中の分子の構造が熱変性したときに生じる微小な熱量変化を測定し、熱安定性を評価します。

特長

- 標識試薬不要
- 溶液中のサンプルの安定性や同等性を評価
- サンプルの充填、セルの洗浄など全機能を完全自動制御^{*3}
- 同等性評価機能と解析 SOP（標準作業基準）の作成が可能
- FDA 21CFR Part11 に対応（オプション）



取得可能パラメータ

T_m 、 ΔH 、 ΔC_p 、 T_{onset}

測定温度範囲

2 °C ~ 130 °C

セル容量

130 μ L

*1 アカデミア価格は、大学及び公的研究機関向けです

*2 完全自動制御対応機種は PEAQ-ITC Automated となります

*3 完全自動制御対応機種は PEAQ-DSC Automated となります

元素分析

卓上・PC 一体型 EDX

Epsilon1

イプシロン 1

希望販売価格（税抜）460 万円～（設置調整費込）
アカデミア価格^{*1} 販売価格をご照会下さい。



特長

- 重量 24 kg。軽量の制御用 PC 一体型 XRF システム（PC 拡張可能）
- 真空系不要。大気中測定であらゆるサンプル形態に対応
- 高い ROI と最小限のコストで元素分析（分析コスト 100 円以下 / 測定）
- ユーティリティは 100 V 電源以外不要
- CCD カメラを内蔵した 1 mm φサイズのスポットサンプル観察に対応の微小部測定モデルもご用意

^{*1} アカデミア価格は、大学及び公的研究機関向けです。

| |
|-------------------------------|
| 測定範囲 |
| 11 Na ~ 95 Am |
| 装置構成 |
| 管球セラミックス絶縁 X 線管球 : Ag アノード |
| X 線管球出力 : 10 W |
| 検出器 : LN2 不要・高分解能 SDD |
| 最大計数率 : 1,500 kcps |
| 真空系 : 不要 |
| 自動モニター校正機能 : 付属 |
| 大型試料ステージ : 付属 |
| ソフトウェア : 日本語 |
| 設置条件 |
| 電源 : 100 ~ 240 V |
| 液体窒素不要モデル |
| サイズ : H384 × W395 × D375 (mm) |
| 重量 : 24 kg |
| 設置可能環境 : 5 ~ 35°C (結露無き事) |
| 磁場変動 : < 30 A/m |
| 粉塵レベル : 一般的なレベル以下、IP40 |

卓上型・EDX

Epsilon4

イプシロン 4

希望販売価格（税抜）843 万円～



特長

- 真空系不要、大気測定であらゆるサンプル形態に対応
- 業界初、スイッチング発生器を採用。KV-mA を測定元素の最適条件に設定することで S/N 比を改善し、ppm レベル分析が可能に
- 最大 1,500 kcp というリニアリティを持つ計数回路を搭載。より正確な校正へ

| |
|-------------------------------|
| 測定範囲 |
| 6 C ~ 95 Am / 9 F ~ 95 Am |
| 装置構成 |
| X 線管球アノード : Ag, Rh, Mo |
| X 線管球出力 : 15 W / 10 W |
| 検出器 : LN2 不要・高分解能 SDD |
| 最大計数率 : 1,500 kcp |
| 真空系 : 不要 |
| 自動モニター構成機能 : 付属 |
| 大型試料ステージ : 付属 |
| 10 試料自動交換機 : 内蔵 |
| スピナー機能 : 付属 |
| ソフトウェア : 日本語他 |
| 設置条件 |
| 電源 : 90 ~ 264 V 47 ~ 63 Hz |
| 消費電力 : 250 VA |
| 液体窒素不要 |
| サイズ : H270 × W530 × D510 (mm) |
| 重量 : 47 kg |
| 設置可能環境 : 5 ~ 35°C (結露無き事) |
| 磁場変動 : < 30 A/m |
| 粉塵レベル : 一般的なレベル以下、IP40 |
| He ガス : 任意置換時 (PC 制御) |

元素分析・前処理装置

オールインワン (WDX+EDX)

Zetium

ゼティウム

希望販売価格 (税抜) 1,700 万円～



特長

- WDX のプラットフォームに EDX 機能が搭載可能。高速・高精度分析、局所分析、マッピング分析に対応可能なハイブリッド XRF
- 業界初のドリフトフリー管球により、標準化校正・ドリフト補正の工数が最小限に
- 特許技術による X 線管球の長寿命化により、ランニングコストの大幅削減が可能
- チラー不要の 1kW タイプからハイエンドの 4kW タイプまでの幅広いラインナップで、バルク・液体・粉体・薄膜等、様々なニーズに対応

| |
|---|
| 測定範囲 |
| 4 Be ~ 95 Am |
| 装置構成 |
| X 線管球アノード: Ag, Cr 及び Rh |
| X 線管球出力: 1, 2.4, 3, 4 kW |
| マッピング機能: 選択可能 (オプション) |
| ゴニオメータ: DOPS 制御 (2,400° / 分) |
| 局所分析: 500 μm ~ (オプション) |
| EDX 機能: 選択可能 (オプション) |
| 波高分布校正: PHD 自動機能付属 |
| ソフトウェア: 日本語 |
| 設置条件 |
| 電源: 200 ~ 240 V |
| コンプレッサーエア: < 0.5 MPa |
| サイズ: H1,510 × W840 × D1,120 (mm) |
| 重量: 600 kg (4 kW モデル) |
| 設置可能環境: 10 ~ 30°C (結露無き事) |
| 磁場変動: EN61000-6-2 に適合 |
| 粉塵レベル: IP20 空冷もしくは水冷冷却水送水装置 (1 kW モデルは不要) |

卓上型・試料前処理装置

LeNeo/TheOx Advanced[®]

レネオ / ジオックス アドバンスド

希望販売価格 (税抜) 400 万円～
700 万円～



特長

- XRF 用ガラスビード作成、ICP 用アルカリ溶解、AA 用乾式分解の前処理が一台で可能
- フッ化水素酸などの危険な酸が不要で、残渣の無い完全分解を実現
- 前処理の所要時間は 1 試料あたり約 15 分
- 高純度 (99.98%)・超高純度 (99.995+%) のフラックスを用意。ガラス化で吸湿性の心配も無く、あらかじめ剥離剤を混合した提供も可能
- 高い温度精度で 6 試料同時に試料調製可能

| |
|--|
| 装置構成 |
| 加熱方式: 電気抵抗炉 |
| 加熱範囲: RT ~ 1,200 °C |
| 自社製フラックス: LIT/LIM、混合タイプも準備 |
| 冷却水: 不要 |
| 作成レシピの提供: 可能 |
| 制御: タッチスクリーンオペレーション |
| 外部ポート: USB ポート付属 |
| 設置条件 (LeNeo) |
| 電源: 200 ~ 240 V 50/60 Hz 対応 |
| 最大負荷電流: 20 A |
| サイズ: H535 × W550 × D585 (mm) |
| 重量: 33 kg |
| 設置可能温度: 5 ~ 35°C |
| 設置環境湿度: 50 ~ 80 % |
| 外部放熱: 1,700 W (装置より 2 cm 離れた場所) |
| 排熱温度: 100 °C (装置より 2 cm 離れた場所) |
| 設置条件 (TheOx Advanced[®]) |
| 電源: 単相 200 V ~ 240 V 50/60 Hz |
| 最大負荷電流: 30 A |
| サイズ: H630 × W1,100 × D620 (mm) |
| 重量: 97 kg (TheOx Advanced [®] 本体) |
| 設置可能温度: 5 ~ 35°C |
| 設置環境湿度: 50 ~ 80% |
| 外部放熱: 5,000 W |
| 排熱温度: 120 °C (装置より 15 cm 離れた場所) |

構造解析

卓上型 XRD

Aeris

エアリス

希望販売価格（税抜）880万円～



特長

- 大型装置と同じ機構を持つゴニオメータ (DOPS) と検出器を搭載
- 据置機と同等の性能を卓上機で実現。高精度リートベルト分析にも対応可能
- 試料水平方式の採用で粉末試料の脱落の心配なし
- 指先も X 線管理区域に入ることのない徹底した安全設計
- 透過測定・薄膜測定にも対応

X 線管球

Cu, Co

装置構成

試料水平 θ - θ ゴニオメータ

出力: 300 W

オプション

1D → 2D の検出器変更

300 W → 600 W の出力変更

高分解能パッケージ

6 試料チェンジャ

結晶構造解析ソフトウェアオプション

ICDD データベース

設置条件

電源: 100 V、200 V、15 A

冷却水循環装置内蔵

サイズ: H690 × W770 × D786 (mm)

重量: 180 kg

多目的 XRD

Empyrean

エンピリアン

希望販売価格（税抜）1,980万円～



特長

- 多様なサンプル測定に自動光学系が対応
- 簡単操作で XRD を実現
- SAXS (X 線小角散乱)、電池透過オペランド測定、薄膜測定、温度可変等の高度な測定にも柔軟に対応
- 金属など蛍光 X 線が発生しやすい試料のノイズを低減する高エネルギー分解能半導体検出器もご用意

X 線管球

Cu, Co, Mo, Ag

装置構成

X 線光学系 iCore, dCore (集中法、平行法、微小部、SAXS 光学系自動交換)

検出器: OD, 1D, 2D 対応 PIXcel 検出器

オプション

5 軸 ($\Phi\chi$ XYZ) クレードル

非接触高さ調整センサ、CCD カメラ

高温、低温チャンバ

各種解析ソフトウェア: 粉末、極点、SAXS、残留応力、Reflectivity、Epitaxy

設置条件

電源: 本体 200 V 単相、冷却水 200 V 三相

循環装置: 室内水冷、空冷又は室外空冷

サイズ: H1,947 × W1,400 × D1,162 (mm)

重量: 1,050 kg

薄膜 XRD

X'Pert³ MRD

エキスパート³ MRD

希望販売価格（税抜）2,400万円～



特長

- 4 インチウエハの全面 XY マップ (MRD) と 8 インチウエハの全面 XY マップ (MRDXL)
- 幅広い測定に対応する Prefix 光学系モジュール
- 薄膜研究の初期段階、面内配向や極点図からエピタキシャル膜の歪み解析などエピタキシャル薄膜の分析に最適のツール
- 超高速な逆格子マッピングにより極薄膜の測定が可能

X 線管球

Cu, Co

装置構成

試料垂直 ω - 2θ ゴニオメータ

半導体検出 PIXcel

5 軸 ($\Phi\chi$ XYZ) クレードル

オプション

Texture、Reflectivity、Epitaxy

設置条件

電源: 本体 200 V 単相、冷却水 200 V 三相

循環装置: 室内水冷、空冷又は室外空冷

サイズ: H1,972 × W1,370 × D1,131 (mm)

重量: 1,150 kg

カスタマーサポート

バリデーション

所定のトレーニングを修了した有資格者による IQ / OQ や定期点検をご提供します。


保守契約

お客様のニーズに合わせて様々なプランをご用意しております。安定した機器運用のために保守契約をご利用ください。

ヘルプデスク

操作上のご質問はヘルプデスクへ。ハードウェアに関するお問合せも承ります。

●粒子計測機器関連 (P.2 ~ P.8)

 **0120-57-17-14**

●X線分析・関連機器 (P.9 ~ P.11)

03-5733-9780


受付：月～金（祝日除く）9:00-17:00



お問合せ先

スペクトリス株式会社

マルバーン・パナリティカル事業部

 **0120-57-17-14**

東京事業所 〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル
 ラボ併設 TEL:03-5733-9511 FAX:03-6735-8974

神戸事業所 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5-5-2
 ラボ併設 神戸国際ビジネスセンター北館511
TEL:078-306-3806 FAX:078-306-3807

名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-20-19
TEL:052-202-3050 FAX:052-220-6082

大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-24
新大阪第一生命ビル11F
TEL:06-6396-8501 FAX:06-6396-8505

福岡博多営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-11-27
TEL:092-473-3787 FAX:092-510-0536

福岡古賀営業所 〒811-3102 福岡県古賀市駅東2-8-12-203
TEL:092-943-1410 FAX:092-943-1420

取扱店

外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。